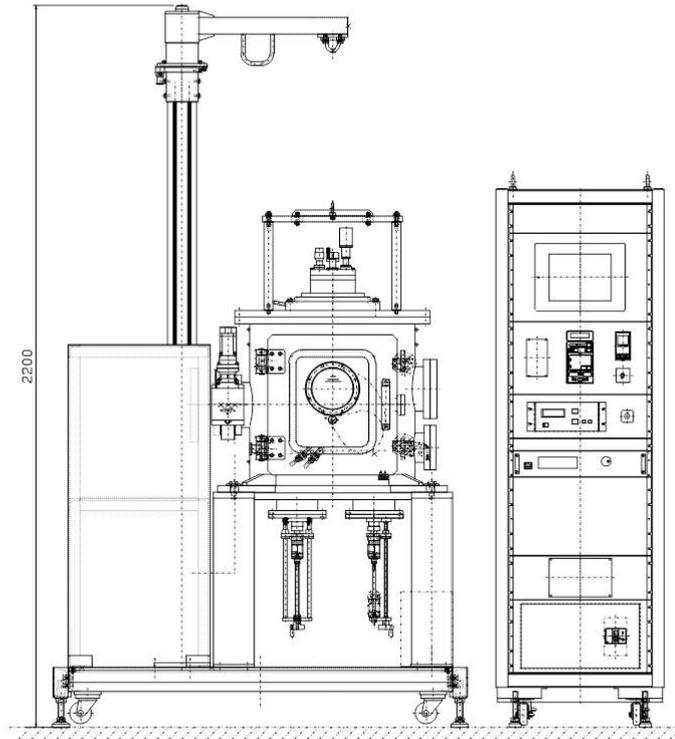


スパッタ装置

Sputtering System



型式: ASP-443-2



装置の詳細仕様、バリエーションに関してはお気軽にお問合せ下さい。

装置名称	スパッタ 装置 (平行対向)	備考
型式	ASP-443-2	
仕様	成膜室: 寸法550(ID)X600(H) mm, G.B.B処理	水冷パイプ巻き
	スパッタ源: φ4”x3元, マグネトロン水冷式	自動シャッター付
	電源: RF電源1000W、自動マッチング付 1台	切替により電源を供給 電源数量方式変更可能
	基板: サイズφ4”,ランプ加熱, 温度500以上	自公転機構付
	成膜室真空度: 5X10 ⁻⁵ Pa以下	ポンプ組合せ選択可能
	ガス導入系: MFC+ストップバルブ, 3系統	必要に応じて変更可能
	オプション: 準備室、イオンソース等	必要に応じて増設
設置及電源	外観寸法: 240(W)X150(D)X240(H) cm 電源: 単相 200V 60A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com